

October 23, 2026

중국, AI·바이오헬스·태양광 기술 수출규제 확대

I. 배경 및 개요

중국 상무부와 과학기술부는 2026년 10월 16일 <상무부·과학기술부 2026년 제48호 공고>(이하 “본건 공고”)를 발표하고, <중국 수출금지·수출제한 기술목록>(이하 “기술목록”)의 개정안에 관하여 2026년 11월 15일까지 의견을 수렴한다고 밝혔습니다. 이번 개정안은 AI·바이오헬스·태양광 분야의 기술 40개를 기술목록에 추가하였으며, 이 중 14개는 수출금지, 26개는 수출제한 대상으로 분류할 예정입니다. 한편, 본건 공고는 발표일부터 기술목록이 정식 개정·시행되기 전까지 추가된 기술에 대해 수출 전에 임시등록을 하도록 규정하였습니다.¹

최근 중국의 AI·바이오헬스·태양광 기술이 빠르게 발전하면서 해외 기술 라이선스, 국제 공동연구 및 해외 생산거점 구축 역시 활발해지고 있습니다. 상무부는 이들 기술의 민감 분야 활용이 확대되고 주요국들이 이미 수출통제를 시행하고 있는 점을 개정 배경으로 들면서도, 이번 개정이 특정 국가·지역 또는 기업을 겨냥한 것이 아닌 상시적 기술무역 관리업무라고 설명하였습니다. 이번 개정은 핵심기술에 대한 수출관리 범위를 확대하는 한편, 구체적인 기술지표와 관리범위, 편의조치 등을 정하여 기술의 특성과 거래 방식에 따라 차등적으로 관리하려는 것이 특징입니다.² 특히 기술목록 개정안은 아직 의견수렴 단계에 있지만, 수출 전 임시등록 의무는 이미 시행되고 있어, 진행 중인 기술협력 및 투자거래에도 영향을 미칠 수 있습니다.

II. 주요 내용

1. 기술목록의 법적 성격과 개정 경과

기술목록은 중국의 <대외무역법> 및 <기술수출입관리조례> 등에 따른 기술수출 관리의 주요 근거로, <대외무역법> 제20조에 따라 상무부가 관계 부처와 함께 제정·조정합니다. 수출금지 기술은 수출할 수 없고, 수출제한 기술은 허가를 받아야 하며, 그 밖의 자유수출 기술은 원칙적으로 수출이 가능하되 기술수출계약 등록의무가 적용됩니다. 기술수출은 기술자료의 물리적 반출에 한정되지 않으며, 기술 소유권의 이전, 해외 사용허락 및

1 중국 상무부·과학기술부 2026년 제48호 공고(2026. 10. 16.). “商务部 科技部公告2026年第48号 就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见并对相关技术出口实施临时登记管理”. https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2026/art_0a31a3c9ac404f7a9b0e917ce3412997.html

2 중국 상무부 대변인(2026. 10. 16.). “商务部新闻发言人就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》答记者问”. https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfyth/art/2026/art_d7661dbf62794345a221404f82a25959.html

기술이전을 수반하는 서비스 제공 등도 포함될 수 있습니다.

한편, 기술목록에 따른 기술수출 관리는 <수출통제법> 및 <이중용도품목 수출통제조례>에 따른 이중용도품목 수출통제와는 별개의 제도입니다. 기술목록은 중국이 관리가 필요하다고 지정한 일반 산업기술을 금지·제한으로 나누어 관리하는 반면, 이중용도품목 수출통제는 이중용도 시스템·장비·재료·소프트웨어·기술을 대상으로 하며 캐치올(catch-all) 통제와 역외적용 규정을 두고 있습니다. 따라서 동일한 거래에 두 제도가 중첩적으로 적용되는지도 함께 검토할 필요가 있습니다.

기술목록은 2001년 처음 공표된 이후 2008년, 2020년, 2023년 및 2025년에 개정·조정되었으며, 최근에는 개정 주기가 짧아지고 전략적 중요성이 높은 기술을 중심으로 관리 대상이 확대되는 추세입니다. 최근 주요 개정 경과를 다음과 같습니다.

- **2020년:** AI 관련 기술 신규 추가 및 기존 항목 조정
- **2023년:** 라이다(LiDAR) 시스템, 유전자 편집 관련 기술 등 신규 추가
- **2025년:** 배터리 양극재 제조기술 신규 추가, 비철금속 제련기술 항목에 리튬 추출 통제기준 추가 및 갈륨 추출 통제기준 수정
- **2026년(이번 개정안):** AI·바이오의약·태양광 분야 기술 40개 추가 및 수출 형태에 따른 관리기준 구체화

2. 신규 지정 예정 기술 40개의 주요 범위

신규 지정 예정 기술은 AI 23개, 바이오의약 5개, 태양광 12개이며, 아래에서는 한국 기업의 사업과 관련성이 높은 기술을 중심으로 분야별 주요 내용을 살펴봅니다. 전체 기술목록과 구체적인 통제기준은 별첨 <중국 수출금지·수출제한 기술목록에 추가할 AI·바이오의약·태양광 기술 범위(의견수렴안)>를 참고하시기 바랍니다.

- **AI(23개):** 대형모델, AI 에이전트, AI 반도체 설계, 연산 클러스터, 정보처리·정보대항 기술 등
 - **주요 제외·편의조치:** 오픈소스·논문으로 이미 공개된 기술 제외, API·SaaS 등 서비스 제공은 대형모델 기술수출에 해당하지 않음
- **바이오의약(5개):** CGT·siRNA 공정 플랫폼, 신규 표적 발굴·검증, 병원성 미생물 기술
 - **주요 제외·편의조치:** 플랫폼은 소유권 이전만 금지, 신규 표적 기술의 라이선스는 자동허가 등 편의조치 적용
- **태양광(12개):** 폴리실리콘·웨이퍼·태양전지 제조기술
 - **주요 특징:** 통제기준을 충족하는 기술이 적용된 핵심 설비도 포함되나, 일반 태양광 완제품과 공고에 명시되지 않은 설비는 원칙적으로 제외

1) AI: 대형모델, AI 반도체 및 기반기술

AI 분야의 신규 지정 예정 기술 23개에는 대형모델, AI 에이전트, 반도체 설계, 컴퓨팅 클러스터 및 정보처리 기술 등이 포함됩니다.

수출금지 대상으로는 중국의 핵심 데이터를 학습에 활용하여 해외에 서비스를 제공하는 대형모델, 특정 고위험 환경에서 사용되는 고성능 에이전트, AI 기반 악성코드 생성·변형 기술 등이 추가되었습니다.

수출제한 대상으로는 중국의 중요 데이터를 학습에 활용하여 해외에 서비스를 제공하는 대형모델과 함께, 학습 연산량이 10^{26} FLOPs 이상이거나 매개변수가 2조 개 이상인 모델, 또는 세계 최상위 수준의 성능을 갖춘 모델과 관련된 핵심기술도 포함됩니다. 이러한 핵심기술에는 모델 가중치, 주요 체크포인트, 기반 소스코드 및 학습·최적화 기술 등이 해당합니다. 또한 AI 반도체의 아키텍처, 자체 명령어 집합, AI 연산용 IP Core 및 기반 소프트웨어 스택 등과 관련된 설계기술도 일정한 요건을 충족하는 경우 수출제한 대상에 포함될 수 있으며, 구체적으로는 14nm 이하 공정, 2.5D/3D 첨단 패키징 또는 특정 용도의 반도체 설계기술이 이에 해당할 수 있습니다. 아울러 3D 플래시메모리 및 메모리 반도체 설계, 대규모 연산 클러스터의 고속 인터커넥트·분산학습·작업 스케줄링 기술, AI를 활용한 취약점 탐지 기술 등도 포함됩니다.

다만 오픈소스 공개나 학술논문 발표 등을 통해 이미 공개된 기술은 관리 대상에서 제외됩니다. 상무부 대변인은 수출제한 대상인 대형모델을 활용하여 해외 이용자에게 API·APP·웹페이지·SaaS를 통한 서비스를 제공하거나, 경량화된 AI 모델을 현지 단말기에서 구동하도록 하는 경우에는 대형모델 기술수출 관리 대상에 해당하지 않는다고 설명하였습니다.

반면 수출제한 대상 AI 기술을 해외에 현지화 배포(로컬 배포)하는 경우에는 기술수출 관리 대상에 해당하며, 다만 해외 자체 클라우드 등 위험이 비교적 통제 가능한 환경에 배포하는 경우에는 자동허가 등 편의조치가 적용될 수 있습니다. 또한 AI 기술의 오픈소스 공개, 중국 기업의 해외 자체 연산센터 구축·운영, 해외 반도체 테이프아웃, 해외 자원을 활용한 공동연구개발 및 국제표준 제정 참여 등에는 자동허가 등 편의조치가 적용될 예정입니다.

2) 바이오의약: 기반 플랫폼 기술과 거래 방식별 차등 관리

바이오의약 분야에서는 세포·유전자치료(CGT), 소간섭 RNA(siRNA) 의약품 및 병원성 미생물 관련 기술 5개가 신규 지정 대상에 포함되었습니다. 이 중 자체 지식재산권을 보유하고 다수의 의약품 개발에 반복적으로 활용할 수 있는 CGT·siRNA 관련 공정 플랫폼 기술과 일정 요건을 충족하는 병원성 미생물 유전자 조작 기술 등은 수출금지

대상으로, 자체 지식재산권을 보유한 신규 표적 발굴·검증 기술은 수출제한 대상으로 각각 분류될 예정입니다.

이번 바이오의약 분야 개정안은 핵심 기술 플랫폼과 개별 의약품을 구분하고, 기술의 소유권 이전과 라이선스 허여를 구분하여 관리한다는 점이 특징입니다. 수출금지 대상으로 제시된 공정 플랫폼의 경우, 플랫폼 자체의 소유권을 해외로 이전하는 행위만을 금지하며, 소유권 이전을 수반하지 않는 해외 라이선스, 위탁 연구·생산 서비스 및 개별 의약품의 해외 사업개발(BD) 과정에서 필요한 연구·시험·생산·품질관리·인허가 및 규제 대응 관련 기술과 공정은 해당 플랫폼 기술의 관리범위에서 제외됩니다. 한편, 수출제한 대상으로 제시된 신규 표적 발굴·검증 기술을 해외 라이선스 방식으로 수출하는 경우에는 자동허가 등 편의조치가 적용되며, 수출제한 기술 일반에 대해서도 공중보건 비상사태, 인도적 구호, 해외 자원을 활용한 공동연구개발 등에 필요한 수출에는 자동허가 등 편의조치가 적용될 예정입니다.

따라서 이번 조치는 여러 의약품에 공통으로 활용되는 핵심 개발 플랫폼 및 신규 표적 발굴기술에 중점을 두고 있으며, 개별 신약의 해외 개발·상업화를 위한 협력까지 일률적으로 제한하는 것은 아닙니다.

3) 태양광: 핵심 제조공정과 관련 설비

태양광 분야에서는 폴리실리콘, 웨이퍼 및 태양전지 제조 등 주요 공정과 관련된 12개 기술을 신규 지정할 예정입니다. 수출금지 대상에는 일정 기준을 충족하는 실란 유동층 공정, 두께 70 μ m 이하의 웨이퍼 제조기술, 페로브스카이트 및 탠덤 태양전지 모듈 생산기술 등이 포함되며, 수출제한 대상에는 단일 생산라인의 연간 생산능력이 3만 톤 이상인 폴리실리콘 엔지니어링 기술, 일부 단결정 실리콘 잉곳 및 초박형·대형 웨이퍼 제조기술, TOPCon·XBC·HJT 등 고효율 결정질 실리콘 태양전지 제조기술 등이 포함됩니다.

태양광 분야에서는 일정한 통제기준을 충족하는 기술이 적용된 주요 설비까지 수출관리 대상에 포함된다는 점이 특징입니다. 상무부 대변인은 태양광 핵심기술의 수출이 생산라인의 수출·설치·시운전·개량 및 업그레이드 과정에서 수반되는 경우가 많다고 보고, 이러한 활동을 하는 수출자는 규정에 따라 기술수출 허가증을 신청하고 이를 근거로 외환·은행·세무·세관 절차를 진행하여야 한다고 설명하였습니다. 따라서 기술 라이선스뿐 아니라 관련 설비의 수출이나 생산라인 설치·시운전·개조 과정에서 수반되는 기술이전에도 규제가 적용될 수 있습니다. 다만 상무부는 공고에 명시되지 않은 다른 태양광 설비는 원칙적으로 이번 조치의 적용 대상이 아니며, 규제 대상 기술을 활용하여 생산된 일반 태양광 완제품 역시 이번 조치만으로 수출이 제한되는 것은 아니라고 설명하였습니다.

3. 수출 전 임시등록 의무의 시행

본건 공고는 2026년 10월 16일부터 개정 기술목록이 시행되기 전까지 공고 첨부목록에 열거된 기술을 수출하려는 경우 사전에 임시등록을 할 것을 요구하고 있으며, 이미 시작되었으나 완료되지 않은 기술 수출에도 적용됩니다. 임시등록 대상은 ① 지식재산권 양도 등 기술 소유권의 해외 이전, ② 지식재산권 사용허락 등 중국 내 기술의 해외 사용허락, ③ 중국 내 기술의 소유자 또는 실질적 지배자가 해외 주체로 변경되는 경우, ④ 상무부가 통지 등으로 등록을 요구하는 그 밖의 경우입니다. 상무부 대변인은 기술목록 관리범위에 포함되는 태양광 핵심 설비를 수출하는 경우에도 모두 등록하여야 하며, 수출하려는 기술이 임시등록 대상인지는 수출자가 스스로 판단하여야 한다고 설명하였습니다.

임시등록은 상무부 업무시스템 통합플랫폼(eCOMP, <https://ecomp.mofcom.gov.cn>)의 '기술무역관리정보' 애플리케이션을 통해 진행합니다. 등록 정보에는 기술수출자와 기술수령자의 기본정보, 수출 국가 또는 지역, 수출 예정 기술과 그 용도, 예상 기술수출 금액 등이 포함되며, 동일한 수령자에게 여러 기술을 한 번에 수출하는 경우에는 합산하여 기재할 수 있습니다. 임시등록은 수출허가와와는 별개의 절차이므로, 임시등록 의무가 시행되었다고 하여 개정안에 따른 수출금지·수출제한 조치까지 시행되는 것은 아닙니다.

III. 우리 기업에 대한 시사점

1. 대상 기술과 거래 방식에 따른 적용 여부 검토

이번 개정안은 우리 기업의 관심이 높은 AI·반도체·바이오의약·태양광 기술에 대해 구체적인 통제기준을 설정하는 한편, 기술 양도·라이선스·서비스 제공 등 거래 방식별로 관리범위와 편의조치를 달리 정하고 있습니다. 따라서 해당 기술의 구체적인 내용 외에도 취득하려는 권리의 범위와 실제로 제공받는 기술자료 및 서비스의 내용도 함께 확인할 필요가 있습니다.

예컨대 한국 기업이 중국 AI 모델을 API 또는 SaaS 방식으로 이용하는 경우와 모델 가중치·소스코드를 제공받아 국내 서버에 직접 구축·운영하는 경우에는 기술수출 규정의 적용 여부가 달라질 수 있습니다. 바이오의약 분야에서는 개별 신약의 해외 개발·상업화를 위한 라이선스를 취득하는 경우와 여러 의약품 개발에 활용할 수 있는 기반 플랫폼 자체를 인수하는 경우를 구별할 필요가 있습니다. 따라서 계약의 명칭이나 형식보다는 실제 이전되는 기술의 내용과 권리의 범위를 기준으로 규제 적용 여부를 판단해야 합니다. 태양광 관련 거래에서도 기술 라이선스뿐만 아니라 생산라인·핵심 설비의 수출 및 이에 수반되는 공정기술의 이전 여부를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

2. 중국 내 연구개발 성과의 해외 이전 및 기술기업 인수

중국에 연구소나 생산법인을 두고 있는 한국 기업은 계열사 간 기술이전에도 유의할 필요가 있습니다. 중국 법인이 개발한 AI 모델, 반도체 설계 등 관련 기술을 한국 본사나 다른 해외 계열사에 양도하거나 라이선스하는 경우, 그룹 내부거래라는 이유만으로 중국의 기술수출 규제 대상에서 제외되는 것은 아닙니다. 특히 본건 공고의 첨부목록에 열거된 기술을 한국 본사나 해외 계열사에 양도하거나 라이선스하는 행위가 공고에서 정한 수출 유형에 해당하는 경우에는, 그룹 내부거래라 하더라도 기술수출 전에 임시등록을 하여야 합니다. 따라서 중국 내 연구개발 성과의 소유권과 실제로 해외에 이전하려는 기술의 내용 및 범위를 확인하고, 관련 등록·허가 의무가 있는지 검토하는 것이 바람직합니다.

본건 공고는 중국 내 기술의 소유자 또는 실질적 지배자가 해외 주체로 변경되는 경우도 임시등록 대상으로 명시하고 있습니다. 따라서 한국 기업이 해당 기술을 보유한 중국 기업을 인수하는 경우, 기술을 해외로 직접 이전하지 않더라도 임시등록 의무가 발생할 수 있습니다. 다만 간접 지분양도, 소수지분 투자, 그룹 내부 지배구조 개편 등의 경우에는 실제 지배권의 변동 여부와 중국 당국의 관련 해석 등을 고려하여 임시등록 대상에 해당하는지 개별적으로 판단할 필요가 있습니다. 현재까지 '실질적 지배자'의 판단기준은 공개되지 않았으므로, 지분율 외에도 이사 선임권, 주요 사항에 대한 거부권, 경영진 지명권 등 거래 후 지배구조를 종합적으로 점검하고, 해석이 불분명한 경우 의견수렴 절차를 활용하거나 당국에 사전 문의하는 방안을 고려할 수 있습니다.

3. 등록·허가 절차와 규제 변경을 거래계약에 반영

임시등록 의무는 이미 시행 중이며, 개시되었으나 아직 완료되지 않은 기술수출에도 적용됩니다. 이에 따라 우리 기업은 현재 진행 중인 기술도입·라이선스·공동연구 및 관련 M&A 거래에서 중국 측 거래상대방이 잔여 기술의 인도나 권리 이전에 앞서 임시등록을 해야 하는지를 우선 확인할 필요가 있습니다. 신규 거래의 경우에도 계약 체결이나 기술 인도 단계에서 관련 규제 문제가 발생하지 않도록, 초기 협의 단계부터 해당 기술이 규제 대상에 해당하는지 검토하는 것이 바람직합니다.

계약상으로는 등록·허가 신청의 주체와 당사자 간 협조의무를 명확히 하고, 기술 인도 시기 및 거래종결 조건과 함께 허가 거부·지연이나 규제 변경에 따른 대응방안도 마련할 필요가 있습니다. 예컨대 ① 임시등록 완료 및 (필요시) 수출허가 취득을 거래종결 또는 기술 인도의 선행조건으로 정하는 조항, ② 허가 지연에 대비한 거래종결 기한(long-stop date) 및 해제 조항, ③ 등록·허가 자료 제공 등 협조의무 조항, ④ 규제 변경 시 재협상·대체이행 조항, ⑤ 규제 대상이 아닌 기술과 규제 대상 기술을 나누어 인도하는 분할 인도 조항 등을 검토할 수 있습니다. 특히 새롭게 수출금지·제한 대상으로 지정될 가능성이 있는 기술이 거래의

핵심인 경우에는, 향후 기술이전이 불가능해지거나 지연되는 상황에 대비하여 대체 이행방안과 당사자 간 책임 분담을 미리 정해두는 것이 바람직합니다.

아울러 기술별 통제기준, 그룹 내부거래에 대한 적용범위 또는 자동허가 등 편의조치에 관하여 불명확한 사항이 있는 기업은 2026년 11월 15일까지 의견을 제출하는 방안을 고려할 수 있습니다. 상무부는 기술목록을 동태적으로 조정할 예정이라고 밝힌 만큼, 최종 개정 내용과 후속 시행기준도 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.

[거래 유형별 점검 체크리스트]

- **중국 AI 모델 이용:** API-SaaS 이용인지, 가중치·소스코드를 제공받아 국내에 구축하는지 확인 → 후자의 경우 중국 측 임시등록허가 필요 여부 검토
- **바이오 라이선스·인수:** 개별 품목 라이선스인지, 플랫폼 소유권 양수인지 확인 → 플랫폼 소유권 이전은 수출금지 대상이 될 수 있음
- **태양광 설비·생산라인 도입:** 기술 라이선스 외에 핵심 설비 수입, 설치·시운전 서비스에 수반되는 기술이전 확인 → 설비 수출도 등록 대상
- **중국 법인의 계열사 간 기술이전:** 첨부목록 기술의 양도·라이선스인지 확인 → 그룹 내부거래라도 임시등록 필요
- **중국 기술기업 인수:** 거래 후 실질적 지배자가 해외 주체로 변경되는지 확인 → 기술의 물리적 이전이 없어도 임시등록 필요 가능
- **진행 중인 거래:** 잔여 기술 인도·권리 이전 전에 중국 측 임시등록 완료 여부 확인 및 계약상 대응조항 점검

[별첨] <중국 수출금지·수출제한 기술목록에 추가할 AI·바이오의약·태양광 기술 범위(의견수렴안)>
(비공식 번역본으로, 정확한 내용은 본건 공고 첨부 1 원문을 확인하시기 바랍니다.)

(1) 인공지능³

수출금지 부분

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
1	인터넷 및 관련 서비스업	266401J	고성능 탐지기술	중국의 네트워크 데이터 국외 이전에 따른 보안위험의 예방 및 대응을 위해 전용으로 또는 주로 사용되는 위조 판별 시스템 및 장비의 제조기술로서, 심층합성(Deep Synthesis) 영상·음성·이미지 또는 멀티모달 정보의 탐지 정확도 및 재현율이 각각 95% 이상인 기술.

³ 오픈소스 공개, 학술논문 발표 등의 방식으로 이미 공개 영역에 진입한 기술은 관리 대상에 포함되지 않음.

2		266402J	정보대항 기술	1. 다음 중 어느 하나의 특성을 가지며 국가 핵심정보인프라, 국방·군수산업, 핵심 정부업무 등 고도의 민감성을 가진 시스템을 공격하거나 국가안보 방어체계를 우회하는 데 사용될 수 있는 AI 자율 구동형 악성코드 생성 및 변형 기술: (1) 다중 엔진 악성코드 탐지기에 대한 공격 성공률 60% 이상; (2) 단일 주요 백신 프로그램에 대한 공격 성공률 85% 이상; (3) 머신러닝 모델에 대한 공격 성공률 90% 이상. 2. 다음 중 어느 하나의 특성을 가지며 국가 핵심정보인프라, 국방·군수산업, 핵심 정부업무 등 고도의 민감성을 가진 시스템을 공격하거나 국가안보 방어체계를 우회하는 데 사용될 수 있는 적대적 환경에 대한 적응형 진화 및 실행 중 동적 행위 수정 기술: (1) 가상화 샌드박스·디버거·에뮬레이터를 탐지하고 보안제품의 종류·버전을 식별하거나 샌드박스 탈출을 구현; (2) 악성 기능을 온전히 유지하면서 실행할 때마다 코드 구조 또는 제어 흐름의 50% 이상을 자동 재작성. 3. 다음 중 어느 하나의 특성을 가지며 국가 핵심정보인프라, 국방·군수산업, 핵심 정부업무 등 고도의 민감성을 가진 시스템을 공격하거나 국가안보 방어체계를 우회하는 데 사용될 수 있는 백신 탐지를 회피하는 변종 악성코드를 자동으로 대량 생성하고, 분산된 환경에서 대규모로 배포하는 기술 (1) 1 회에 기능은 같고 구조는 다른 변종 20 개 이상 생성 또는 엔드투엔드 자동화율 80% 이상; (2) 단일 기준 페이로드를 바탕으로 24 시간마다 구문트리 차이도가 30% 이상인 변종을 10 개 초과 생성; (3) 표본 변종의 샌드박스 내 행위 프로파일 일치율 90% 이상.
3	소프트웨어 및 정보기술 서비스업	266501J	AI 대규모 모델 기술	중국의 핵심데이터를 이용하여 학습한 후 서비스를 제공하는 대규모 모델. 주: '핵심데이터'의 범위는 「중화인민공화국 데이터안전법」 등 관련 법령에 따라 정한다.
4		266502J	AI 에이전트 기술	국가 핵심정보인프라, 국방·군수산업, 핵심 정부업무 등 고도의 민감성을 가진 분야에 전용으로 또는 주로 적용되며 고성능 수준에 도달한 AI 에이전트. 주: '고성능'이란 266505X 제한류 AI 에이전트 기술의 통제지표에 도달한 것을 의미한다.

수출제한 부분⁴

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
5	인터넷 및 관련 서비스업	266402X	고성능 탐지기술	(해당 유형 기술의 기존 7 개 항목에 다음 항목 추가) 8. 심층합성 영상·음성·이미지 또는 멀티모달 정보의 탐지 시스템 및 장비 제조기술로서 정확도 및 재현율이 각각 98% 이상인 기술. 9. 다음 특성을 모두 충족하는 영상·이미지 정보 은닉 및 추출 기술: (1) 높은 강건성: 비트 오류율 0.5% 이하 또는 재현율 99.9% 이상; (2) 낮은 오경보율: 위양성률(FPR) 0.1% 이하; (3) 높은 비인지성: 구조적 유사도 지수(SSIM) 0.999 이상이거나, 최대 신호대잡음비(PSNR) 41dB 이상 또는 학습 기반 지각 이미지 패치 유사도(LPIPS) 0.005 이하.
6		266404X	정보대항 기술	(해당 유형 기술의 기존 5 개 항목에 다음 항목 추가) 6. 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 AI 보조 취약점 발굴 기술: (1) 공신력 있는 보안 벤치마크 테스트에서 취약점 재현 또는 악용 가능성 판정 점수 75% 이상; (2) 공개된 기존 취약점의 분석부터 완전한 악용 체인 구축까지 독자적으로 수행하는 엔드투엔드 성공률이 주요 운영체제·브라우저에 대해 50% 이상이거나 임의 코드 실행 수준의 악용 구성에 대해 40% 이상; (3) 취약점 발굴·악용 효율이 숙련 보안전문가 기준 대비 10 배 이상이거나 표준 취약점 데이터베이스 보안 벤치마크 테스트에서 악용 가능한 취약점 발견 건수가 10 배 이상; (4) 위험도가 낮거나 중간인 소프트웨어 결함 2 개 이상을 자율적으로 연결하여 완전한 다단계 공격 체인을 구성하고 실행 가능한 개념증명(PoC) 코드 생성; (5) 통상적 테스트체계에서 주요 오픈소스 프로젝트 또는 주요 운영체제 하나에서 미공개 고위험 보안결함 5 개 초과 또는 미공개 보안결함 50 개 초과를 한 번에 자율 발견; (6) 국내외 주요 취약점 악용능력 등급체계상 최고 등급 도달.
7	소프트웨어 및 정보기술 서비스업	266501X	정보처리 기술	(해당 유형 기술의 기존 18 개 항목에 다음 항목 추가) 19. 음성·성문 핵심 알고리즘 기술, 공격 방지·위조 방지 기술, 성문 인식 시스템 기술, 성문 데이터 처리·보호 등을 포함하며, 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 성문 인식 기술:

⁴ 이 유형의 기술을 오픈소스로 공개하는 경우 및 중국 기업이 해외에 컴퓨팅 자원 센터를 자체 구축·운영하거나, 해외에서 반도체 칩의 테이프아웃(Tape-out) 및 제조를 진행하거나, 해외 자원을 활용하여 공동 연구개발을 수행하거나, 국제표준 제정에 참여하는 경우 등의 기술 수출에 대해서는 자동허가 등 간소화 조치를 적용한다.

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
8				(1) 위양성률(FPR) 0.01% 이하, 등록 음성 길이 30 초 이하, 테스트 음성 길이 10 초 이하, 음성 신호대잡음비 20dB 이상의 조건에서 진양성률(TPR) 99.1% 이상; (2) 1 회 성문 처리의 엔드투엔드 지연 300 밀리초 이하 및 처리량 초당 100 건 이상; (3) 녹음 재생·음성 합성·음성 변환 등 일반적 사기 공격의 전체 탐지율 98% 이상 또는 오수락률 1% 이하; (4) 소수민족 언어 또는 특정 지역 방언에 특화된 성문 인식 최적화 능력을 갖추고 표준 테스트조건에서 인식 정확도 90% 이상. 20. 중국어 및 소수민족 언어 번역에 특별히 또는 주로 사용되며 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 번역기술: (1) 표준 테스트세트의 사람 평가에 따른 평균의견점수(MOS) 4.8 이상; (2) 번역의 의미 충실도가 95% 이상인 조건에서 일반 분야 번역의 표준 번역문과의 유사도점수(BLEU) 35 이상 또는 전문 분야 번역의 표준 번역문과의 유사도점수(BLEU) 30 이상.
		266504X	AI 대규모 모델 기술	1. 중국의 중요데이터를 이용하여 학습한 후 서비스를 제공하는 대규모 모델. 2. 가중치 매개변수, 주요 체크포인트, 기반 소스코드, 아키텍처 설계, 학습 최적화·추론 가속 등의 기술을 포함하며 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 대규모 모델의 핵심기술: (1) 연산량 10²⁶ 회 이상의 부동소수점 연산; (2) 매개변수 수가 2 조 개 이상; (3) 성능이 세계 선도 수준에 도달. 주: ① 소량(0.1% 이하)의 중요데이터만 학습에 사용하고 해당 데이터가 관련 분야 모델의 핵심기술 연구개발 능력을 실질적으로 향상시키지 않으며 비식별화·정제 등 안전조치로 출력에 해당 데이터가 재현되지 않거나, 해당 중요데이터를 적법하게 공개 취득할 수 있는 경우 제 1 항의 관리범위에서 제외한다. ② '중요데이터' 범위는 「중화인민공화국 데이터안전법」 등 관련 법령에 따른다. ③ '성능이 세계 선도 수준에 도달'이란 수출 당시 국내외 주요 평가기관·대규모 산업 플랫폼 등이 대규모 모델의 종합성능, 전문업무 능력, 전 세계 호출량, 안전성, 학습효율 등을 공개 평가한 결과 세계 상위 10 위에 해당함을 말한다.
		266505X	AI 에이전트 기술	1. 자연어 명령을 실행 가능한 하위 작업 20 단계 이상의 체인으로 자동 분해하고 작업 분해 정확도 80% 이상, 하위 작업 평균 성공률이 90% 이상인 자율 계획·수립 및 작업 분해 기술.

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
				2. 동시 협업 에이전트 60 개 이상을 지원하고 동일한 효과 기준 전체 작업 완료시간이 단일 에이전트의 최소 완료시간의 2 배 이하이며, 다중 에이전트 최종 결론과 표준답안의 일치율이 85% 이상인 협업 아키텍처 기술. 3. 제 3 자 도구 200 개 이상을 통합 지원하고 도구 선택 정확도가 90% 이상이며, 3 종 이상의 도구를 협업 호출해야 하는 작업의 엔드투엔드 평균 성공률이 90% 이상인 도구 호출 및 시스템 조작 기술. 4. 다음 특성을 모두 가진 AI 게임·대결 의사결정 기술: (1) 단일 작업의 의사결정 계획 깊이 20 단계 이상 또는 동시 게임 에이전트 10 개 이상; (2) 전략 적응 능력을 갖추고 복잡한 동적 게임의 의사결정 지연 200 밀리초 이하 및 제어단위 10 개 이상; (3) 표준 게임 벤치마크에서 인간의 90%를 초과하는 성능.
10		266506X	AI 칩 설계기술	1. 칩 아키텍처, 자체 개발 명령어 집합, 지능형 연산 IP 코어, 지원 기반 소프트웨어 스택 등을 포함하며 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 AI 처리칩 설계기술: (1) 14nm 이하 제조공정 사용 필요; (2) 부동소수점 또는 정수 연산능력 보유; (3) 2.5D·3D 첨단 패키징 집적기술 적용; (4) 고속 상호연결 능력 보유; (5) 메모리 내 연산·뉴로모픽 컴퓨팅 등 비(非)폰 노이만형 신구조 기반; (6) 자율주행·컴퓨터 비전·지능형 음성 등 특정 분야에 적용 가능. 2. 메모리칩 설계기술: (1) 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 3D 플래시 메모리칩 설계기술: ① 저장밀도 8Gb/mm² 이상; ② I/O 속도 1.5Gbps 이상; ③ 본딩 기술 적용. (2) 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 메모리칩 설계기술: ① 18nm 이하 메모리 제조공정 사용 필요; ② 수직 채널 트랜지스터 구조 적용; ③ 본딩 기술 적용; ④ 다층 적층 수행.
11		266507X	AI 컴퓨팅 클러스터 기술	1. 대규모 AI 컴퓨팅 클러스터의 칩 간 또는 노드 간 고속 상호연결 기술로서 양방향 대역폭 800GB/s 이상. 2. 대규모 AI 컴퓨팅 클러스터에서 분산 학습의 안정적 운용을 보장하고 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 분산 학습 장애허용 기술:

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
				(1) 체크포인트 복구 메커니즘의 평균 장애복구시간(MTTR) 120 초 이하; (2) 자동 장애 감지 및 작업의 무중단 이전을 지원하고 장애로 인한 학습 작업의 가시적 중단시간 30 초 이하; (3) 일반적인 클러스터 규모에서 네트워크 장애로 인한 GPU 유효 컴퓨팅능력 낭비율 5% 이하. 3. 대규모 AI 컴퓨팅 클러스터의 통신 효율을 최적화하고 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 고효율 통신 스케줄링 기술: (1) 선형 확장성 98% 이상; (2) 동적 토폴로지 인식 라우팅 및 다중 플레인 간 부하분산 능력을 갖추고 엔드투엔드 통신 지연 시간 1 마이크로초 이하; (3) 통신과 연산의 높은 중첩을 지원하고 통신 은닉률 90% 이상. 4. 대규모 AI 컴퓨팅 클러스터에서 서로 다른 제조사 2 곳 이상의 AI 칩을 통합 스케줄링·협업 추론하도록 지원하고 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 이기종 클러스터 고효율 추론·스케줄링 기술(이기종 컴퓨팅자원 통합 스케줄링 프레임워크, 혼합정밀도 협업 학습 기술, 이기종 추론 최적화 기술, 이기종 클러스터 지능형 운영 유지보수 기술 등을 포함): (1) 2 종 이상의 고속 통신 프로토콜 통합 적응 및 혼합 스케줄링을 지원하고 칩 간 통신 대역폭 이용률 90% 이상 또는 노드 간 단말측 통신 지연 시간 5 마이크로초 이하; (2) 2 종 이상의 서로 다른 아키텍처 연산 노드의 통합관리를 지원하고, 이기종 추론 클러스터 처리량 성능이 단일 칩 클러스터 방식보다 30% 이상 증가하거나 AI 가속카드 평균 이용률 65% 이상 증가하거나 추론비용 20% 이상 감소하거나 클러스터 평균 장애복구시간이 10 분 이하이면서 가용성이 99.9% 이상; (3) 지리적으로 분산된 2 곳 이상의 AI 컴퓨팅센터 통합 컴퓨팅자원 스케줄링·작업배분을 지원하고 지역 간 스케줄링 학습효율이 단일 클러스터의 80% 이상이거나 지역 간 이기종 컴퓨팅자원의 실시간 부하분산·작업 이전을 지원. 주: '대규모 AI 컴퓨팅 클러스터'란 AI 가속카드 총수가 10,000 장을 초과하는 연산 주체를 말한다.

(2) 바이오의약

수출금지 부분

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
1	의약품 제조업	262704J	세포·유전자치료 원천기술	독자적인 지식재산권을 보유한 세포·유전자치료 기술·공정 플랫폼. 주: ① 소유권의 국외 이전만 금지한다. 국외 라이선스 허여, 관련 기술·공정을 이용한 위탁 연구개발·생산 서비스 제공 등 소유권을 국외로 이전하지 않는 경우는 관리범위에 포함되지 않는다. ② 서로 다른 연구개발·생산 단계에 있는 특정 의약품 품목의 국외 협력 또는 사업개발(BD) 거래 과정에서 연구개발·시험·생산·품질관리·출시 및 규제준수 등에 필요한 기술·공정은 관리범위에 포함되지 않는다. ③ '기술·공정 플랫폼'은 장기간 연구개발로 축적된 재사용 가능한, 복수 의약품 개발을 지원할 수 있는 일련의 기반 공통기술을 말한다. 단일 의약품 품목의 개발기술·공정은 제외한다.
2		262705J	소핵산 의약품 원천기술	독자적인 지식재산권을 보유한 소간섭 RNA(siRNA) 의약품 기술·공정 플랫폼. 주: ① 소유권의 국외 이전만 금지한다. 국외 라이선스 허여, 관련 기술·공정을 이용한 위탁 연구개발·생산 서비스 제공 등 소유권을 국외로 이전하지 않는 경우는 관리범위에 포함되지 않는다. ② 서로 다른 연구개발·생산 단계에 있는 특정 의약품 품목에 관한 국외 협력 또는 사업개발(BD) 거래 과정에서 연구개발·시험·생산·품질관리·출시 및 규제준수 등에 필요한 기술·공정은 관리범위에 포함되지 않는다. ③ '기술·공정 플랫폼'은 장기간 연구개발로 축적된 재사용 가능한, 복수 의약품 개발을 지원할 수 있는 기반 공통기술을 말한다. 단일 의약품 품목의 개발기술·공정은 제외한다.
3	연구 및 시험개발업	267302J	병원성 미생물 기술	다음 중 어느 하나의 특성을 가진 병원성 미생물의 인공 유전자 변형 및 지향성 계대배양을 통한 기능 증강 기술: (1) 알려진 또는 잠재적 병원성 미생물의 기능 강화 기술; (2) 병원성 미생물의 대규모 증식, 지향성 진화 가속 및 특정 병원성 특성의 안정적 유지를 위한 계대배양 체계·공정; (3) 자연 진화 과정을 모사하는 인공적 통제 계대배양 유도 기술.

수출제한 부분⁵

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
4	의약품 제조업	262705X	세포·유전자치료 원천기술	독자적인 지식재산권을 보유한 세포·유전자치료 분야의 완전히 새로운 표적 발굴·검증 기술. 주: ① '완전히 새로운 표적'이란 전 세계에서 특허, 학술문헌, 공개 데이터베이스, 산업기술자료, 학술회의 등을 통해 공개된 적이 없는 약물 표적을 말한다. ② '완전히 새로운 표적 발굴·검증 기술'이란 완전히 새로운 표적을 선별·발굴·확인하고 의약품 개발 가능성이 있는 약물 작용 부위를 특정하는 기술을 말한다.
5		262706X	소핵산 의약품 원천기술	독자적 지식재산권을 보유한 소간섭 RNA(siRNA) 분야의 완전히 새로운 표적 발굴·검증 기술. 주: ① '완전히 새로운 표적'이란 전 세계에서 특허, 학술문헌, 공개 데이터베이스, 산업기술자료, 학술회의 등을 통해 공개된 적이 없는 약물 표적을 말한다. ② '완전히 새로운 표적 발굴·검증 기술'이란 완전히 새로운 표적을 선별·발굴·확인하고 의약품 개발 가능성이 있는 약물 작용 부위를 특정하는 기술을 말한다.

(3) 태양광⁶

수출금지 부분

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
1	비금속 광물제품 제조업	263003J	폴리실리콘 제조기술	1. 단일 생산라인의 삼염화수소실란 생산능력이 연간 25 만 톤 이상인 냉수소화 유동층 공정 및 그 장비 제조기술. 2. 단일 생산라인 생산능력이 연간 2 만 톤 이상인 실란 유동층 반응기 공정 및 그 장비 제조기술.
2		263004J	실리콘 웨이퍼 제조기술	두께가 70 마이크로미터 이하인 실리콘 웨이퍼 제조기술 및 그 장비 제조기술. 주: '실리콘 웨이퍼 제조기술'에는 프로그램 코드, 기반 알고리즘 모델, 장비 도면 등이 포함된다.

5 공중보건 비상사태 대응, 인도적 구조, 해외 자원을 활용한 공동 연구개발 및 해외 라이선스 허여 등의 경우에 이루어지는 기술 수출에 대해서는 자동허가 등 편의조치를 적용한다.

6 기술 관리 범위에는 관련 기술을 구현하는 핵심·주요 장비도 포함되며, 구체적으로는 삼염화실란 냉수소화 유동층 반응기, 실란 유동층 반응기, 환원로, 태양광용 실리콘 웨이퍼 절단 장비, 태양광용 단결정 인상에 사용되는 단결정로, 태양광용 실리콘 웨이퍼 제조를 위한 절단·각형 가공 등 기계가공 장비, 태양광용 실리콘 웨이퍼 절단 장비, 하프셀 또는 다분할 공정용 예지 패시베이션 장비(EPD), 터널 산화막 및 도핑된 폴리실리콘 선택적 패시베이션 접착층 증착 장비(PECVD 및 LPCVD 두 종류 장비 포함), 원자층 증착(ALD) 장비, 고온 붕소 확산로, TOPCon 태양전지용 구리 전기도금 장비, HBC 및 HTBC 태양전지용 결정질 실리콘 박막 증착(PECVD) 장비, XBC 태양전지용 구리 전기도금 장비, 투명 전도성 박막 증착(PVD) 장비, 비정질 또는 미세결정질 실리콘 박막 증착(PECVD) 장비, 이중접합 태양전지용 구리 전기도금 장비, 슬롯다이 코팅 장비 등이 포함된다.

3	전기기계 및 장비 제조업	263801J	태양광 전지 제조기술	1. 다음 조건을 모두 충족하는 결정질 실리콘 태양전지 제조용 에지 패시베이션 전용 기술 및 그 장비 제조기술: (1) 전체·반절·다분할 태양광 실리콘 웨이퍼에 사용 가능하고 전체 웨이퍼 크기 기준 각 변 길이 182~230mm; (2) 실리콘 웨이퍼 두께 140μm 이하. 2. 페로브스카이트 및 탠덤 전지 모듈 생산기술 및 그 장비 제조기술: (1) 페로브스카이트·결정질 실리콘 탠덤 전지 기술: 양산 웨이퍼 크기 182mm 이상 및 효율 30% 이상; (2) 페로브스카이트 전용 슬롯다이 코팅 기술: 가공 폭 1.1m 이상; (3) 대면적 단일접합 페로브스카이트 전지 모듈 기술: 모듈 면적 1m² 이상 및 효율 18% 이상; (4) 대면적 탠덤 페로브스카이트 전지 모듈 기술: 모듈 면적 1m² 이상 및 효율 28% 이상.
---	---------------------	---------	----------------	---

수출제한 부분

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
4	비금속 광물제품 제조업	263004X	폴리실리콘 제조기술	1. 단일 생산라인 생산능력이 연간 3 만 톤 이상인 폴리실리콘 엔지니어링 기술. 2. 단일 환원로의 폴리실리콘 생산능력이 연간 800 톤 이상인 환원공정 및 그 장비 제조기술. 주: '엔지니어링 기술'에는 장비 엔지니어링 설계, 공장 건설 설계, 공정 패키지 등이 포함된다.
5	비금속 광물제품 제조업	263005X	실리콘 웨이퍼 제조기술	1. 태양광용 단결정 실리콘 잉곳 인상기술 및 그 장비 제조기술로서 다음을 포함함: (1) 로 챔버 내경이 1,600mm 이상인 단결정 성장로의 설계·적용 방안; (2) 크기가 35 인치 이상인 단결정 성장로의 핫존 설계·적용 방안; (3) 인상속도가 1.2mm/분 이상인 단결정 성장로 설계·적용 방안; (4) 등경(동일 직경) 소비전력 40kW 이하인 단결정 성장로 설계·적용 방안. 2. 태양광용 단결정 실리콘 잉곳 기계가공 기술 및 그 장비 제조기술: (1) 반절단 잉곳의 절단·연삭 제조·가공 기술; (2) 길이가 720mm 이상인 실리콘 잉곳 제조에 사용 가능한 기계가공 기술. 3. 초박형 대형 태양광 실리콘 웨이퍼 제조기술 및 그 장비 제조기술:

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
				(1) 어느 한 변의 길이가 182mm 이상인 직사각형 실리콘 웨이퍼의 제조에 사용할 수 있는 기술; (2) 130μm 이하 두께의 실리콘 웨이퍼 제조에 사용할 수 있는 기술: ① 직경 28μm 이하의 텅스텐 와이어 절단 기술; ② 주축 회전속도 6,500rpm 이상 또는 메인 롤러 직경 120mm 이하 또는 메인 롤러 가로축 간격 370mm 이하인 절단장비 설계·적용 방안.
6	전기기계 및 장비 제조업	263802X	태양광 전지 제조기술	1. 고효율 터널산화막 패시베이션 접착(TOPCon) 및 고효율 후면접착(XBC) 결정질 실리콘 태양전지 제조기술과 그 장비 제조기술: (1) 다음 조건을 모두 충족하는 초박형 터널산화막 및 도핑된 폴리실리콘 선택적 패시베이션 접착층의 저압 화학기상증착(LPCVD)·플라즈마 강화 화학기상증착(PECVD) 태양광 전용 코팅기술: ① 전체·반절·다분할 웨이퍼에 사용 가능하며, 전체 웨이퍼 기준 각 변의 길이가 182~230mm; ② 실리콘 웨이퍼 두께 140μm 이하; ③ G12 전체 웨이퍼 기준 LPCVD 장비 생산능력 시간당 6,000 장 이상 및 PECVD 장비 생산능력 시간당 6,000 장 이상. (2) 다음 조건을 모두 충족하는 산화알루미늄 표면 패시베이션층 원자층증착(ALD) 태양광 전용 코팅기술: ① 전체 웨이퍼 기준 각 변의 길이 182~230mm; ② 실리콘 웨이퍼 두께 140μm 이하; ③ G12 전체 웨이퍼 기준 생산능력 시간당 12,000 장 이상. (3) 다음 조건을 모두 충족하는 고온 붕소 확산 태양광 전용 기술: ① 전체 웨이퍼 기준 각 변의 길이 182~230mm; ② 실리콘 두께 140μm 이하; ③ G12 전체 웨이퍼 기준 생산능력 시간당 4,500 장 이상. (4) 다음 조건을 모두 충족하는 TOPCon 전지 구리 전기도금 전극 제조기술: ① 전체·반절·다분할 웨이퍼에 사용 가능하며, 전체 웨이퍼 기준 각 변 길이 182~230mm; ② 실리콘 두께 140μm 이하. (5) 다음 조건을 모두 충족하는 저온 비정질·미세결정 실리콘 증착 및 PECVD 태양광 전용 코팅기술: ① 전체·반절·다분할 웨이퍼에 사용 가능하며, 전체 웨이퍼 기준 각 변의 길이 182~230mm; ② 실리콘 웨이퍼 두께 140μm 이하. (6) 다음 조건을 모두 충족하는 XBC 전지 전기도금·무전해 도금 기술:

번호	산업 분야	기술번호	기술명	통제 요건
				① 전체·반절·다분할 웨이퍼에 사용되며, 전체 웨이퍼 기준 각 변의 길이 182~230mm; ② 두께 140μm 이하. 2. 이종접합(HJT) 결정질 실리콘 태양전지 제조기술 및 그 장비 제조기술: (1) 두께 110μm 이하 웨이퍼 가공에 사용 가능하고 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 HJT 전지 적층 투명전도막 증착기술: ① 투명전도막 인듐 함량 50% 이하; ② G12 웨이퍼 기준 생산능력 시간당 반절 웨이퍼 14,000 장 이상. (2) 두께가 110μm 이하인 실리콘 웨이퍼 가공에 사용 가능하고 다음 중 어느 하나의 특성을 가진 HJT 전지 결정질 실리콘 박막 증착기술: ① 고효율 N 형 HJT 전지용으로 박막 결정화율 40% 이상 또는 G12 웨이퍼 기준 시간당 반절 웨이퍼 14,000 장 이상; ② P 형 HJT 전지용으로 AM1.5 테스트조건에서 최고 변환효율 23% 이상 또는 AM0 테스트조건에서 최고 변환효율 20.5% 이상. (3) 은 함량 30% 이하인 저은(低銀) 은피복 구리 HJT 태양전지 제조기술. (4) 구리 전기도금 전극 HJT 전지 제조기술. 주: 이 유형 기술에서 '고효율'이란 AM1.5 테스트조건에서 전지 평균 변환효율 25% 이상 또는 양산 모듈 평균 변환효율 22.3% 이상을 말한다.

* * *

법무법인 태평양 수출입규제대응센터는 전략물자 및 해외수출통제(ITAR, EAR 등), 방산물자 및 국방과학기술(방위산업기술 포함) 수출통제, 국가핵심기술(NCT) 및 국가첨단전략기술(NHT), 국가안보심의 및 투자심사, 국내외 수출입규제 대응 컴플라이언스 시스템 구축 및 지원, 관세청 등 수사 및 조사 대응, 외환거래 및 대외투자 관리, 국제분쟁 및 조사대응 등 광범위한 영역을 아우르고 있습니다. 각 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 다수의 전문가들이 협업하여, 개별 고객의 상황과 필요에 최적화된 맞춤형 자문 서비스를 제공하고자 합니다.

관련 구성원

권대식

변호사

T 86.10.6461.3650

E daeshik.kwon@bkl.co.kr

김지이나

변호사

T 02.3404.0698

E jeena.kim@bkl.co.kr

황호성

전문위원

T 02.3404.7488

E hosung.hwang@bkl.co.kr

김옥

외국변호사(중국)

T 86.10.6461.3657

E yu.jin@bkl.co.kr

양민석

변호사

T 86.10.6461.3650

E minseok.yang@bkl.co.kr

법무법인(유한) 태평양의 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 법무법인(유한) 태평양의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려드립니다. 뉴스레터와 관련된 문의사항이 있을 경우 위 연락처로 문의 주시기 바랍니다.